(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[4]
G03H 3/00

(11) 공개번호 특1986-0009325
(43) 공개일자 1986년12월22일

(21) 출원번호 특1986-0003552
(22) 출원일자 1986년05월07일
(30) 우선권주장 60-96469 1985년05월07일 일본(JP)
60-115067 1985년05월28일 일본(JP)
60-271174 1985년12월02일 일본(JP)
(71) 출원인 다이니뽄 인사쯔 가부시끼가이샤 기다지마 요시도시
일본국 도오꾜도 신쥬꾸구 이찌가야 가가쪼오 1쪼메 1반 1고
(72) 발명자 다께우찌 사또시
일본국 가나가와껜 가와사끼시 아소구 오오젠지 2456-91
단죠 고다로
일본국 도오꾜도 네리마구 히가리가오까 7-7-2-810
다하라 시게히고
일본국 도오꾜도 신쥬꾸구 이찌가야 다까쇼마찌 6 와까바료
유이 요시하루
일본국 도요꾜도 히가시구루메시 야나기꾸보 3-2-37
이께다 사또시
일본국 도오꾜도 신쥬꾸구 난도쪼오 47 쇼시료
(74) 대리인 김윤배

심사청구 : 없음

(54) 투명형 홀로그램

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

투명형 홀로그램

[도면의 간단한 설명]

제1도, 제2도는 본 발명에 따른 투명형 홀로그램(hologram)단면도이고,

제3도는 본 발명에 따른 투명형 홀로그램 전사시이트의 단면도이며,

제4도는 본 발명에 따른 홀로그램물품을 개략적으로 나타낸 평면도이고,

1 : 투명형홀로그램, 2 : 투명형홀로그램형성층

3 : 릴리프홀로그램형성층 4 : 홀로그램효과층

5 : 표시부 6,34,66 : 보호층

30 : 홀로그램전사시이트 35 : 지지체

32,62 : 접착제층 33 : 박리층

35,65 : 취약질층 36,63 : 앵커(anker)층

40 : 피전사체 60 : 홀로그램시이트

61 : 분리형시이트　　64 : 베이스시이트

70 : 기판

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

투명형홀로그램에 있어서, 투명홀로그램형성층의 홀로그램형성부에 투명박막으로된 홀로그램효과층이 적층되어서 이루어진 투명형홀로그램.

청구항 2

제2항에 있어서, 홀로그램효과층은 투명홀로그램형성층의 굴절율과 서로 다른 굴절율을 갖도록 되어진 것.

청구항 3

제1항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 굴절율 n_2가 투명홀로그램형성층의 굴절율 n_1 보다 적어도 0.1이상 큰 값을 갖도록 되어진 것.

청구항 4

제1항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 두께가 200 의 반사성금속박막으로 되어진 것.

청구항 5

제1항에 있어서, 홀로그램은 릴리프홀로그램으로 되어진 것.

청구항 6

제1항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램효과층이 형성되어진 것.

청구항 7

제1항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램이 형성되어진 것.

청구항 8

제1항에 있어서, 투명홀로그램형성층과 홀로그램효과층은 어느 하나 또는 두층모두의 내부와 표면모두나 내부 또는 표면에 인쇄층이 형성되어진 것.

청구항 9

제1항에 있어서, 투명홀로그램형성층과 홀로그램효과층은 어느 하나 또는 두층모두가 착색되어진 것.

청구항 10

제1항에 있어서, 홀로그램효과층은

(A) 투명홀로그램형성층 보다도 굴절율이 높은 투명강유전체, 또는

(B) 투명홀로그램형성층 보다도 굴절율이 낮은 투명박막, 또는

(C) 투명홀로그램형성층과 굴절율이 다른 수지, 또는

(D) 그 두께가 200Å이하의 금속 박막, 또는

(E) 상기 (A) 내지 (D)를 적절하게 조합시켜서 된 적층체중에서 선택되어진 것으로 이루어진 것.

청구항 11

제1항에 있어서, 홀로그램효과층은

Sio, In_2O_3, Y_2O_3, TiO, ThO_2, Si_2O_3, PbF_2, Cd_2O_3, La_2O_3, MgO, Al_2O_3, LaF_3, CaO, SiO_2, CeF_3, NdF_3, SiO_2SiO_3, ThF_4, Sb_2S_3, Fe203, PbO, ZnSe, CdS, Bi_2O_3, TiO_2, $PbCl_2$, $Ce02Ta_2O_5$, ZnS, ZnO, CdO, Nd_2O_3, Sb_2O_3, ZrO_2, WO_3, Pr_6O_{11}, CdSe, CdTe, Ge HfO_2, PbTe, Si Te, TICI, and ZnTe 중에서 선택하여 박막으로 형성시킨 것.

청구항 12

투명형 홀로그램전사시이트에 있어서, 그 지지체의 임의의 면에 투명형 홀로그램과 접착제층이 순서대로 적층되어서 이루어진 투명형홀로그램전사시이트.

청구항 13

제12항에 있어서, 투명형 홀로그램은 투명홀로그램형성층의 홀로그램형성부에 투명박막으로 된 홀로그램

효과층이 적층되어진 것.

청구항 14

제13항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 굴절율 n_2가 투명홀로그램형성층의 굴절율 n_1 보다 적어도 0.1이상 큰 값을 갖도록 되어진 것.

청구항 15

제13항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 두께가 200Å의 반사성금속 박막으로 되어진 것.

청구항 16

제13항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램효과층이 형성되어진 것.

청구항 17

제13항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램이 형성되어진 것.

청구항 18

제12항에 있어서, 지지체와 투명형홀로그램 사이에는 박리층이 형성되어서 이루어진 것.

청구항 19

제13항에 있어서, 박리층과 투명홀로그램사이에는 보호층이 형성되어서 이루어진 전사시이트.

청구항 20

제19항에 있어서, 박리층과 보호층 및 투명형홀로그램은 미세하게 형성되어 있고, 그들 중 적어도 하나는 착색되어진 것.

청구항 21

제12항에 있어서, 홀로그램은 릴리프홀로그램으로 되어진 것.

청구항 22

제12항에 있어서, 투명형 홀로그램과 접착제 사이에는 취약질층이 형성되어서 이루어진 전사시이트.

청구항 23

제12항에 있어서, 투명홀로그램은 인쇄층을 가진 것.

청구항 24

제12항에 있어서, 투명홀로그램은 착색되어진 것.

청구항 25

투명형홀로그램시이트에 있어서, 분리형 시이트의 임의의면에 접착제층을 매개로하여 투명형홀로그램과 적층되어진 투명형홀로그램전사시이트.

청구항 26

제25항에 있어서, 투명형홀로그램은 투명형홀로그램 형성층이 홀로그램형성부에 투명박막으로 된 홀로그램효과층의 적층되어서 이루어진 것.

청구항 27

제26항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 굴절율 n_2가 투명홀로그램형성층의 굴절율 n_1 보다 적어도 1.00이상 큰 값을 갖도록 되어진 것.

청구항 28

제25항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 표면에 홀로그램의 표면을 보호하기 위하여 보호층이 형성되어진 것.

청구항 29

제26항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 두께가 200Å 이하의 반사성금속박막으로 되어진 것.

청구항 30

제26항에 있어서, 투명형 홀로그램형성층은 그 표면에 베이스시이트가 적층된 것.

청구항 31

제30항에 있어서, 투명형 홀로그램형성층과 베이스시이트는 미세하게 형성되어 있고 그들 중 하나는 착색되어진 것.

청구항 32

제26항에 있어서, 투명홀로그램형성층과 홀로그램효과층은 매우 미세하게 형성되어 있고 그들 중 적어도 하나는 착색되어진 것.

청구항 33

제26항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램효과층이 형성되어진 것.

청구항 34

제26항에 있어서, 투명홀로그램형성층은 그 일부분에 홀로그램이 형성되어진 것.

청구항 35

제25항에 있어서, 투명홀로그램과 접착제의 사이에는 취약질층이 형성되어서 이루어진 시이트.

청구항 36

제25항에 있어서, 투명형홀로그램은 인쇄층을 가진 것.

청구항 37

제25항에 있어서, 투명형홀로그램은 착색되어진 것.

청구항 38

제25항에 있어서, 홀로그램형성층은 릴리프홀로그램으로 되어진 것.

청구항 39

기판의 표면 또는 내부에 투명형홀로그램이 형성되어진 투명형홀로그램물품.

청구항 40

제39항에 있어서, 투명형홀로그램은 투명형홀로그램형성층의 홀로그램형성부에 투명박막으로 된 홀로그램효과층이 적층시켜서 된 것.

청구항 41

제40항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 굴절율 n_2가 투명홀로그램형성층의 굴절율 n_1 보다 적어도 1.00이상 큰 값을 갖도록 되어진 것.

청구항 42

제40항에 있어서, 홀로그램효과층은 그 두께가 200Å의 반사성금속박막으로 되어진 것.

청구항 43

제40항에 있어서, 홀로그램은 릴리프홀로그램으로 되어진 것.

청구항 44

제40항에 있어서, 홀로그램효과층은 투명홀로그램형성층에 부분적으로 형성되어진 것.

청구항 45

제40항에 있어서, 홀로그램은 투명홀로그램형성층에 부분적으로 형성되어진 것.

청구항 46

제40항에 있어서, 투명홀로그램형성층과 홀로그램효과층은 어느 하나 또는 두층모두의 그 내부와 표면모두나 내부 또는 표면에 인쇄층이 형성되어진 것.

청구항 47

제40항에 있어서, 투명홀로그램형성층과 홀로그램형성층은 어느 하나 또는 두층모두가 착색되어진 것.

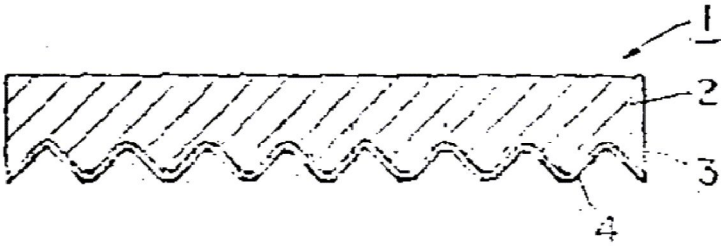
청구항 48

제40항에 있어서, 홀로그램형성층은 기판을 겸하도록 되어진 것.

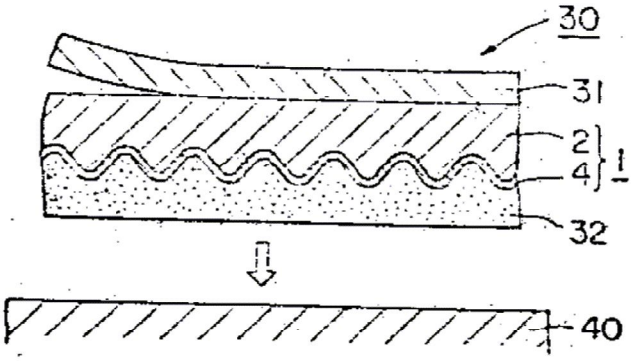
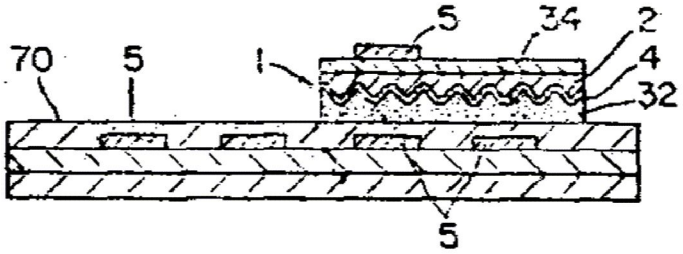
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면3



도면14